

## ピリミジフェン試験法

### 1. 分析対象化合物

ピリミジフェン

### 2. 装置

アルカリ熱イオン化検出器又は高感度窒素・リン検出器付きガスクロマトグラフ及びガスクロマトグラフ・質量分析計を用いる。

### 3. 試薬, 試液

総則の3に示すものを用いる。

### 4. 標準品

ピリミジフェン 本品はピリミジフェン99%以上を含む。

融点 本品の融点は71~72°Cである。

### 5. 試験溶液の調製

#### a 抽出法

検体約1 kgを精密に量り, 必要に応じ適量の水を量って加え, 細切均一化した後, 検体20.0 gに相当する量を量り採る。

これにアセトン100 mLを加え, 3分間細砕した後, ケイソウ土を1 cmの厚さに敷いたろ紙を用いてすり合わせ減圧濃縮器中に吸引ろ過する。ろ紙上の残留物を採り, アセトン50 mLを加え, 3分間細砕した後, 上記と同様に操作して, ろ液をその減圧濃縮器中に合わせ, 40°C以下でアセトンを除去する。

これをあらかじめ10%塩化ナトリウム溶液100 mLを入れた300 mLの分液漏斗に移す。*n*-ヘキサン100 mLを用いて上記の減圧濃縮器のナス型フラスコを洗い, 洗液を上記の分液漏斗に合わせる。振とう機を用いて5分間激しく振り混ぜた後, 静置し, *n*-ヘキサン層を300 mLの三角フラスコに移す。水層に*n*-ヘキサン50 mLを加え, 上記と同様に操作して, *n*-ヘキサン層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え, 時々振り混ぜながら15分間放置した後, すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。次いで*n*-ヘキサン20 mLを用いて三角フラスコを洗い, その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を2回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ, 40°C以下で*n*-ヘキサンを除去する。この残留物に*n*-ヘキサン5 mLを加えて溶かす。

#### b 精製法

内径15 mm, 長さ300 mmのクロマトグラフ管に, カラムクロマトグラフィー用合成ケイ酸マグネシウム5 gを*n*-ヘキサンに懸濁したものを, 次いでその上に無水硫酸ナトリウム

約5 gを入れ、カラムの上端に少量の*n*-ヘキサンが残る程度まで*n*-ヘキサンを流出させる。このカラムに a 抽出法で得られた溶液を注入した後、*n*-ヘキサン100 mLを注入し、流出液は捨てる。次いでアセトン及び*n*-ヘキサンの混液（1：19）100 mLを注入し、流出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り、40℃以下でアセトン及び*n*-ヘキサンを除去する。この残留物にアセトンを加えて溶かし、正確に2 mLとして、これを試験溶液とする。

## 6. 操作法

### a 定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。

#### 操作条件

カラム 内径0.25 mm，長さ30 mのケイ酸ガラス製の細管に，ガスクロマトグラフィー用5%フェニル-メチルシリコンを0.25 μmの厚さでコーティングしたもの。

カラム温度 70℃で2分間保持し，その後毎分30℃で昇温し，180℃に到達後1分間保持する。次に毎分5℃で昇温し，250℃に到達後，さらに，毎分10℃で昇温し，280℃に到達後，5分間保持する。

検出器 280℃で操作する。

ガス流量 キャリヤーガスとしてヘリウムを用いる。ピリミジフェンが約27分で流出する流速に調整する。空気及び水素の流量を至適条件に調整する。

### b 定量試験

a 定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

### c 確認試験

a 定性試験と同様の操作条件でガスクロマトグラフィー・質量分析を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。また，必要に応じ，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

## 7. 定量限界

0.01 mg/kg

## 8. 留意事項

なし

## 9. 参考文献

なし

## 10. 類型

